

太平洋知的財産協会 (PIPA) 第35回国際年次総会報告

——2004年10月19日(火)～22日(金) 於：富山市名鉄富山ホテル——

PIPA日本部会長

井 上 学*

目 次

- I. はじめに
- II. 総会の概要
- III. 第一委員会報告
- IV. 第二委員会報告
- V. 第四委員会報告

I. はじめに

第35回PIPA富山国際総会は、富山市にある名鉄富山ホテルで日・米・韓・台から約70名の参加者で、開催された。

総会の内容は次項以下に譲るが、オープニングセレモニーでは、地元YKKの佐藤常務、小野日本特許庁技監、ボーランド米国特許庁国際部長、作田日本知的財産協会理事長からスピーチをいただいた。その後3日間にわたり、メインテーマである中国問題を中心に日米韓から論文発表が行われ、またパネルディスカッションでは例年の1.5倍の時間を使って中国問題について積極的な議論を行い、総会は成功裡に終了した。1日目は猛烈な台風に見舞われたが、2日目の午後のエクスカージョンでは、秋晴れの紅葉の美しい黒部峡谷をトロッコ列車で堪能するとともに、海外からの出席者との交流・親睦を深めた。

PIPAは現在解散手続きを進めており、PIPAとしての国際総会は今回が最後となるが、2005

年度は日本側が日本知的財産協会PIPAプロジェクト、米国側がIPOアジアプラクティス委員会として今までと同様な活動を継続し、9月に米国シアトルで日米合同国際会議を開催する予定である。

II. 総会の概要

第一理事 田邊 潔

第35回PIPA国際総会は、10月19日(火)から22日(金)まで総勢77名(日本43名、米国8名、その他ゲスト、同伴者等)の参加のもとに行われた。

今回は米国部会がIPOの中にアジアプラクティス委員会を設置し、同委員会とPIPA米国部会が連携して活動を行ってきたことから、総会にはPIPA米国部会のメンバーのみならず、IPOのアジアプラクティス委員会所属のメンバーからの参加を得ることができた。なおPIPA米国部会及びIPOメンバーの有志は総会前の週に中国を訪問し、その成果がパネルディスカッション等で反映された。

またメインのテーマを中国問題とすることを2004年早々に決定し、仮想事例を米国側が準備して各メンバーが検討する等し、関連するプレゼンテーション、パネルディスカッション(知財管理全般(主として特許出願管理)、誤訳の

* Manabu INOUE, President of PIPA Japanese Group

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

問題、権利行使の問題、ライセンスの問題等)を日米連携して、精力的に準備した。特にパネルディスカッションを3日間3回にわけ、かつ従来よりも多くの時間を割いて行った。

これ以外にも三極特許庁の審査連携の問題(ドシエ・アクセス・システム)やプロパテントの問題もプレゼンテーションでとりあげている。なお詳細は各委員長の報告に譲ることとするが、いずれも活発な議論が行われた。

また今回の名誉会長は地元富山県に根を張るYKK株式会社の佐藤常務(研究開発センター)にお願いし、YKKの歴史、知財活動について興味深い話を聞くことができた。またゲストスピーカーとしては日本特許庁の小野技監、米国特許庁のポーランド国際部長、日本知的財産協会の作田理事長にお越しいただいて日米特許庁の施策、知財協の活動状況等について興味深いお話を伺うことができた。

なお10月19日の開会式の前日は恒例のグランドレセプションが行われた。旧交を温めたり、ネットワークングに利用していただけたものと思う。

今回はAWARDEEとして元日本部会長として功績のあった中嶋重光氏が選ばれた。米国部会からの祝辞をいただくとともに、記念の楯をお送りした。また、今回の総会に出席いただいた中嶋氏よりお礼の言葉をいただいた。

結果として日米間の民間企業の集まりとして長年活動してきたPIPA国際総会は今回が最後となった。今後日本部会の活動は日本知的財産協会に引き継がれるが、今までの活動に参加された方々が色々な形で知的財産の世界で貢献されることを期待したい。

最後になったが、本総会に参加者を派遣していただいた各会員企業、参加者の方々、更には本富山総会を成功に導くために努力していただいた下記の準備委員、事務局の方々にこの場を借りて感謝の意を表したい。

土井、濱田(事務局)、石原(日立製作所)、石原(松下電器産業)、横野(サッポロビール)、木原(東芝)

Ⅲ. 第一委員会報告

1. 中国現地法人での知的財産管理の留意点

作成者：第一委員会 第1WG¹⁾

発表者：森岡 智昭(豊田中央研究所)

2001年にWTOに加盟し種々の法律、規則の整備が進む中で、外資系企業による研究開発拠点設立が増えている中国の現地拠点において完成した発明の取り扱い、職務発明、及びノウハウ・営業秘密の取り扱いについて外資系企業が留意すべき点を発表した。

まず、中国の研究開発拠点での研究成果によって外資企業本部が利益を得るために、研究成果を外資企業へどのように帰属させるかを検討し、①研究開発拠点設立時の契約、②開発委託時の契約についての留意点を、中国国内法の解釈を踏まえた上で提言した。

次に、中国での職務発明とその発明対価について、日本での特許法35条の動向と対比する形で問題を提起し、契約上の留意点を提言した。

さらに、トレードシークレットについて、中国国内での判例を分析し、雇用時及び退職時の契約上の留意点、特許出願の是非、及び先使用権の活用方法について提言した。

各企業が実際に直面している中国問題に対して価値ある発表であった。

(文責：松原 勝頼(リコー))

2. 中国出願における誤訳調査及び明細書作成実務上の留意点

作成者：第一委員会 第2WG²⁾

発表者：谷津 明生(日立製作所)

出願時における日本語等から中国語への特許明細書等の翻訳、更には中間処理時における翻訳の誤訳チェック方法について、日本企業での

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

現状を調査分析した上で、中国での有効な知的財産権の獲得を目指す企業に対する方策、実務上留意すべき点について発表した。

先ず、日本企業による中国出願の現状として、①国内特許事務所経由の出願が過半数であること、②翻訳ベースが英文、和文、及びその両方がほぼ同じ割合であること、③翻訳は中国事務所で行う場合が過半数であること、④翻訳者以外での翻訳チェックも大半の企業で行っていることが判明し、各企業によってその環境は様々であることを説明した。

次に、実際に発生した誤訳の内容とその原因について事例分析を行った結果を説明した。

さらに、中国出願時及び中間処理時における制度上の留意点を踏まえた上で、誤訳発生を抑制するための、原文明細書の記載方法、テクニカルタームの取り扱い、PCT出願の活用、及び誤訳チェック上の留意点について提言を行った。

企業の集合体であるPIPAのメリットを生かして興味深いデータ収集と提言ができた。

(文責：松原 勝頼 (リコー))

3. ドシエ・アクセス・システムによる三極特許庁における審査連携の概観

作成者：第一委員会 第3WG³⁾

発表者：宮内 達広 (東芝)

日米欧三極特許庁において出願件数の増大に伴う審査滞貨の増加の問題を解決するべく2004年秋より運用されたドシエ・アクセス・システム(三極特許庁の包装袋情報閲覧システム)について、そのシステムの概要、システム利用に伴い三極特許庁において予想される問題点を出願人の立場からの考察、及びその利用方法についての提言を発表した。

先ず、特許庁の運用開始時のドシエ・アクセス・システム、USPTOのPAIRシステム及びEPOのEPOLINEを調査し、自極及び他極にお

けるサーチ結果及び審査結果の利用有無について、三極それぞれに運用方法が異なることを明らかにした。

次に、ドシエ・アクセス・システムが今後特許庁によりどのように運用されるべきかを、出願人の立場から、出願人の負荷、早期権利化等の要因をもとに、第1国でのサーチ結果及び審査結果を利用して、拒絶できないクレームに対してのみ追加のサーチ・審査を行う「追加型利用」での運用を提言した。ただし、審査請求制度を有する日本国での審査開始の遅れは他極における審査結果利用に不公平となり得る点を指摘した。

さらに、本システムの利用による米国でのIDS提出義務緩和要求をUSPTOに強く要求して欲しい旨を特許庁へ提言したが、会場における質疑応答で、特許庁担当者とUSPTO担当者との直接討論を聞いた点でこの発表は有意義であった。

(文責：松原 勝頼 (リコー))

4. The Role and Value of Trade Secrets in IP Management Strategies

作成者・発表者：Karl F. Jorda (Franklin Pierce Law Center)

知的財産分野におけるトレードシークレットは、今まで特許の補完的なものとして考えられてきたが、特許には、特許性が要求される、内容が公開される、コストが高い等の問題があり、また、他社にライセンスされる技術について全てを特許でカバーできるわけでは無い旨を指摘した。

そこで、トレードシークレットを特許の補完として考えるのではなく、特許と同時に、併用して利用することが実際的で利益のある理論的IP戦略であることを提言した。

トレードシークレットと特許の併用により、独占性はさらに強化され、万一何れかが無効又

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は権利行使不可能となった場合でも、もう一方が有効に利用可能となるであろう。

(文責：松原 勝頼 (リコー))

5. General Overview of Patent System in China

作成者：Soonhee Jang (Eli Lilly & Co.)，他
発表者：Jon Wood (Eastman Chemical)

2001年の中国の世界貿易機構 (WTO) への加盟は、知的財産権の行使を含め、中国特許法への関心の高まりをもたらした。特に、中国における特許権の取得及び行使は、諸外国企業が中国においてその実施技術範囲を拡大していくにつれ非常に重要になってきた。

これらの前提より、中国特許法の概要を論じ、中国特許法の歴史的発展、最近の中国特許法の改正、中国における特許出願と実体審査、付与後手続きについての紹介を行った。

特に化学分野における実施内容開示要求への対応、拒絶理由に対する粘り強い対応、及び特許と実用新案の併用についての提言を行った。

(文責：松原 勝頼 (リコー))

6. What a Foreign Applicant Should Know About Patent Prosecution in China

作成者・発表者：Thomas Q.T.Tsai (Tsai, Lee & Chen)

2001年の中国のWTO加盟以来、中国政府による総合的海外投資流入政策は中国を世界最大の海外資本投入先にし、中国は2002年時点で米国、EU、日本に次ぐ世界第4位の貿易国となった。これらを背景に、中国ではWTO規則に適合するように特許法をはじめ諸法令が改正されてきた。

本発表では、海外の出願人が中国において特許を取得する場合に知っておかねばならない中国法の導入として、中国においてなされた発明の所有権、中国においてなされた発明の外国出

願と譲渡の実務、中国の法令のもとでの発明者報酬、中国における特許明細書の準備、特許・実用新案双方の出願の戦略、特許訴追、再審査の訴追や無効審判手続きについて説明を行った。

(文責：松原 勝頼 (リコー))

7. パネルディスカッション

テーマ：中国における外資企業の発明管理
パネリスト

日本側：松原 勝頼 (リコー)

今 博史 (三菱レイヨン)

高橋 光男 (住友電気工業)

中木村 暁利 (東レ知的財産センター)

村上 好也 (沖電気工業)

米国側：Soonhee Jang (Eli Lilly & Co.)

Jon Wood (Eastman Chemical)

Thomas Q.T.Tsai (Tsai, Lee & Chen)

Karl F. Jorda (Franklin Pierce Law Center)

Lawrence Welch (Eli Lilly & Co.)

議論した主な項目及び議論内容は次の通りである。

(1) 第1国出願の問題

外国人が出願人の場合は中国第1国出願不要との意見も含め、インベンターシップ、中国国内法の解釈について様々な意見が出された。現状不明点も多く、手続きについての問題点も議論された。

中国国内での研究成果を自由に処分したい外国企業の本音に対する批判も多いものの、今後の法整備で外国企業にとってのメリットが確約されることが望まれる。

(2) 発明対価の問題

中国特許法上、職務発明は所属単位帰属とな

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

っており、発明者へは譲渡対価支払ではなく褒賞が求められているので、日本とは規定が異なる意見があった。また、中国従業者に対する報償は、中国での収入レベルから見て高額であり、給与とのバランス等の見地から様々な問題点が指摘された。発明対価の問題は今後問題化する可能性が高い。

(3) トレードシークレットの問題

従業者の転職が多く、順法精神も低いことから、あらゆるケースを想定して具体的かつ明瞭に契約に盛り込んでおくことが重要である。特にトレードシークレットの対象を明文化しておくことが大事。

(4) 実用新案制度利用の問題

実用新案制度における早期権利化のメリットを指摘する意見があった一方、権利行使時にその約半数無効化されてしまう現状では、必ずしも有効な手段とはいえないという意見が多かった。

(文責：松原 勝頼 (リコー))

IV. 第二委員会報告

1. プロパテント政策が企業のライセンス戦略に与える影響について

作成者：第二委員会 第1WG⁴⁾

発表者：佐治 博 (リコー)

裁定実施権制度については、ゲノム創薬の研究開発活動を阻害する懸念から、94年日米合意を見直して特許法92条による裁定(自己の特許発明を実施するための通常実施権の設定の裁定)の発動を実現することが長く議論されているが、電気電子機器の分野で特許プールによる標準化技術の普及の可能性が確立するに従い、特許プール外での過度な権利行使を特許法93条の裁定(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)の発動によって抑制しようとする考え

がある。

WG-1では、技術標準策定からパテントプール構築に至る現状のプロセスを検討し、①標準化団体が十分な特許調査を行っていないこと、②パテントプールのライセンス条件は一部の特許権者によって決定されたものであること、③過度な権利行使の公正な認定は困難であることを指摘した上で、特許法93条の裁定が許容されるためには、技術標準策定段階における第三者権利の調査の充実と、裁定の適用基準の明確化が不可欠であるとの提言を行った。

(文責：渡部 比呂志 (日本電信電話))

2. 中国における技術ライセンス戦略

作成者：第二委員会 第2WG⁵⁾

発表者：吉田 芳樹 (藤沢薬品)

知的財産権の侵害者にライセンスを受けさせるには、当事者間での交渉のみならず法的措置(権利行使手段)を併用して圧力をかけることが効果的である。そして、中国では事業開始に先立ってではなく、侵害行為が現実に発見された後にライセンス交渉となるケースが多々ある。WG-2ではそのような現実に立脚し、中国において被疑侵害者にライセンスを受けさせることを最終目的とした一つの交渉戦略について検討し、証拠収集、警告及び話し合い、法的手段による圧力と適切な法的手段の選択、契約締結時の留意点、契約締結後の留意点について時系列的にまとめた。

(文責：渡部 比呂志 (日本電信電話))

3. Selected Issues in Licensing Patents & Know-How in China: A Comparative Analysis

作成者：Jihui Ni (Philips), 他

発表者：Ronald A. Bleeker (Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner L.L.P.)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(1) 中国における特許ノウハウの保護制度

特許権を保護する法制度（特許法）はよく整備されている。近年はノウハウや企業秘密の保護必要性に関する理解も進み、主に不正競争防止法によって保護が図られている。他に、契約法、外国貿易法、技術輸出入管理条例が特許・ノウハウのライセンスと関係する。

(2) 第三者権利侵害の際の補償義務

契約法353条および技術輸出入管理条例24条は、技術ライセンス契約に基づく実施の結果、ライセンシが第三者権利を侵害した場合は、ライセンサが補償義務を負うことを定めている。

中国では先使用を保護する制度がないので、ライセンス契約後に成立した特許権によってライセンサに補償義務が生じる場合がある。また、標準化技術に関する特許の一部をライセンスした場合、ライセンシが当該技術標準準拠の製品を製造すると未許諾の他社の権利を侵害することが想定されるが、この場合、技術輸出入管理条例24条がライセンサにとって不当に解釈されることが懸念される。

(3) 転職者に課す秘密保持契約

中国でも、雇用者に秘密保持義務を課す契約は有効である（労働法22条）。そして、企業は転職者が、3年間、同業他社に就業することを禁止する契約を結ぶことができる（労働大臣による通知）。

しかし、秘密の漏洩が起こっても、ライセンサが雇用者を相手取って訴訟を起こすことはできない。したがって、技術ライセンスにおいて、ライセンシに対し、雇用者に秘密保持義務を課すこと、退職後も一定期間秘密を守ることを約定させることが必要である。

（文責：渡部 比呂志（日本電信電話））

4. Licensing issues: (1) Open source soft-

ware Problems; (2) Co-owner Licensing at will; (3) Reverse Engineering Provisions

作成者：William T. Ellis (Foley & Lardner LLP), 他

発表者：Lawrence Welch (Eli Lilly & Co.)

(1) 中国におけるオープンソースソフトウェア (OSS) ライセンス

OSSライセンスではパッケージ開封による同意 (Shrinkwrap License) やウェブページでのワンクリックによる同意 (Clickwrap License) などの簡易な契約形態を利用して、OSS 使用により発生した損害の賠償、第三者の権利侵害に対する賠償に対して、ライセンサは一切の責任を負わないとする場合が多い。中国でも Shrinkwrap/Clickwrap Licenseは認められているが、契約法39, 40, 41条により、ライセンサが一方的に賠償義務を放棄することは制限されているため、注意が必要である。

(2) 共有特許、共有著作物のライセンス

中国では共有特許権のライセンスと譲渡は全ての権利者の同意が必要である。また、ロイヤリティの分配についても合意が必要である。

共同著作物のライセンスは文書による合意が必要だが、合意に至らない場合は各権利者が個別にライセンスできる。しかし、ロイヤリティは権利者の間で公平に分配されねばならない。

(3) 契約によるリバースエンジニアリングの禁止の可否

これまで争われた事例はないが、契約に従って禁止できると考えられる。

(4) 著作物を保護するための技術的制限手段を回避する行為の禁止

全国人民代表大会に暫定法案が提出されたが通過しなかった。代わりに行政規則が可決され

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たが、実効性は不明である。回避手段の実施行為を罰する法律はない。

(文責：渡部 比呂志 (日本電信電話))

5. パネルディスカッション

テーマ「中国での特許・ノウハウライセンス活動における諸問題について」

パネリスト

日本側：木下 京 (三共)

工藤 裕丈 (富士ゼロックス)

佐治 博 (リコー)

吉田 芳樹 (藤沢薬品工業)

渡部 比呂志 (日本電信電話)

米国側：Ronald A. Bleeker (Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP)

William T. Ellis (Foley & Lardner LLP)

Edward Blocker (Philips)

Jon Wood (Eastman Chemical)

議論した主な項目及び議論内容は次の通りである。

(1) 中国では発見した権利侵害者にライセンス交渉をもちかける場面が多いが、通常、交渉開始材料とする「警告書」を安易に送付することは、相手方優位の裁判所へ提訴されるおそれがあるため、危険である。

(2) 申し立てから48時間以内に侵害行為の差止の裁定、執行が可能となる訴訟前差止め制度は現実に運用されてはいるが、肯定的な裁定が得られる基準は全く不明である。

(3) 中国、特に地方部では、未だ裁判官の資質が低く、地方で裁判を起こすと明確な根拠もなく地元で有利な判決が下される。一方、仲裁人には相応の資格が要求されている。したがって、紛争解決条項としては裁判よりも仲裁が望ましい。

(4) 技術ライセンス契約において、第三者権利侵害の際にライセンサは補償義務を負うことが契約法等で規定されている。特許ライセンス契約で第三者特許侵害補償免責条項を設けた場合、損害額が大きいと重過失として裁判で負ける可能性があるとの意見があった。

(5) ライセンス契約で、相手方の過少支払い、不払いのリスクを低減するためには、固定金、一括払いの契約が有効である。

(6) 中国では人材の流動が激しい。「反不正競争法」の制定により、企業秘密の保護環境が整備されつつあるが、いまだ企業秘密についての意識が薄く、従業員の転職に伴う企業秘密の漏洩が深刻な問題となっている。

(文責：渡部 比呂志 (日本電信電話))

V. 第四委員会報告

1. 中国における権利行使に関する検討

作成者：第四委員会 第1WG⁶⁾

発表者：宮島 正博 (ソニー)

中国企業を知的財産権侵害で提訴する事案が増加してきている。そこで、中国の知的財産権に関する法律を日米の法律と比較し、侵害による損害賠償請求事件の判決を研究した。

発表では、まず中国の損害賠償金額の算定方法に関する規定を確認し、経済的損失と合理的費用について、それぞれ3件の判決を紹介した。経済的損失に関しては、特許権者の販売数減少量を立証するよりは、侵害製品の販売量と特許製品の利益を立証する方が容易であり、特許使用料を根拠に損害賠償金額を請求する方が、立証はより容易であること、また、中国においては、証拠書類の提出に関する規定や、営業秘密を保護する規定がまだ十分に整っていないことを報告した。

合理的費用の請求にあたっては、経済的損失とは区別して請求すること、提出する証拠は当該費用の支出に関連性があるものとする事等

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の留意点を報告した。

さらに、損害賠償に係る日米の現状を概観した後、中国における問題点を指摘した。

(文責：熊澤 佳明 (住友電気工業))

2. 中国における共有特許権の取り扱いについて

作成者：第四委員会 第2 WG⁷⁾

発表者：多田 有為 (オムロン)

外国企業 (現地子会社も含む) が中国の企業・大学などと共有で中国特許を保有する場合、その共有特許権の実施許諾、権利譲渡における中国での法規定および実務上の留意点を検討し、下記のような特徴点を把握できた。

実施許諾：

- ① 実施許諾は有償であると規定されている。
- ② 契約発効日3ヶ月以内に国務院専利行政部門へ届け出が必要。
- ③ 全権利者がライセンスになること。

譲渡：

- ① 国務院専利行政部門へ登記が必要。
- ② 外国への譲渡はさらに国務院関係主管部門の認可が必要。
- ③ 共有権者の一方が譲渡を行う場合、他方が優先的に権利を譲受する権利を有すること。

また、中国における発明者への報奨・報酬についても併せて検討した。中国においては、自社が雇用する発明者に対して報奨を与えることが必要であり、国有企業については報奨額、支払い時が定められている。

(文責：中山 美加 (JSR))

3. パネルディスカッション

テーマ：中国における知的財産権の権利行使について

パネリスト

日本側：泉川 達也 (田辺製菓)

熊澤 佳明 (住友電気工業)

北岡 一人 (日立製作所)

中原 健吾 (松下電器産業)

宮島 正博 (ソニー)

米国側：Lawrence Welch (Eli Lilly & Co.)

他

議論した主な項目及び内容は次の通りである。

(1) 証拠開示制度

米国のディスカバリー制度や日本のインカメラ制度のような証拠開示制度が、中国では明確でない。営業秘密部分について、弁護士だけは確認できるが、まだまだ問題は多い。米国はこの問題について中国に対して20年間、改善を求めて来たが、いまだ改善されていない。

(2) 損害賠償額の上限50万元の問題

損害賠償額が低いとの指摘があるが、2004年10月2週目の最高人民法院判事からのヒアリングにおいては、中国内でも低額であるとの指摘が出ているとのことである。損害賠償額の上限の引き上げを検討しているが、上限撤廃にはならないとのことである。

(3) 訴訟の透明性

証拠の採用、判断について裁判所の裁量が広すぎる。また、判決が出て当事者に通知されないケースもあるとのことである。今後のさらなる改善を望む。

(4) 判決文の公開

裁判所や裁判官が個別に公開しており、ポータルサイトはない。最高人民法院で出される判決にはある程度、拘束力がある。現在、最高人民法院で知的財産権訴訟に関する意見を改定中である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(5) 行政ルート・司法ルートの選択

特許の場合は、技術解釈が必要となってくるので、司法ルートが有利である。現状は、差止めを求めて、行政ルートで対応することが主である。なお、特許の有効性については、中国特許庁が判断することになっており、裁判所では無効の訴えが出来ない。

(文責：泉川 達也 (田辺製薬))

国内に設立した場合のファクト・パターンについて検討がなされ、成果の権利帰属、侵害訴訟リスクの最小化、営業秘密の不正流用等の問題点を指摘した。また、従業者から発明を譲り受けた時の報奨における注意点、さらに侵害訴訟に至った場合の問題点として、地方保護主義や外国人特許権者が不利であることを指摘した。

(文責：泉川 達也 (田辺製薬))

4. Enforcing Patents in China, Japan and the United States

作成者：Zheng Zha (GWU, School of Law)
他

発表者：Raj Davé (Morrison & Foerser)

日中米の特許権の行使について比較検討結果が報告された。特許権の権利行使を行う場合、日米と異なる点は、例えば、侵害事件については司法ルートと行政ルート(税関ルートを含む)とが選択でき、特許権の無効については特許庁のみでしか争うことができず、また、訴訟的確性については特許権者と専用実施権者のみではなく関係人も含まれるなどの点があげられる。中国における特許の権利行使については、法整備がなされたところであり今後の発展に期待する。

(文責：泉川 達也 (田辺製薬))

5. Enforcement of IPRs in China

作成者・発表者：Christopher E. Chalsen
(Milbank, Tweed, Hadley
& McCloy LLP) and
Brenda J. Panichi (P&G
Far East, Inc.)

日中米三カ国の企業間で共同研究契約に基づく共同研究を行った場合や共同出資会社を中国

注 記

- 1) 今 博史 (三菱レイヨン), 高橋 光男 (住友電気工業), 中木村 暁利 (東レ知的財産センター), 村上 好也 (沖電気工業), 森岡 智昭 (豊田中央研究所)
- 2) 伊達 研郎 (三菱電機), 石野 明則 (シャープ), 市川 雅一 (住友化学工業), 谷津 明生 (日立製作所)
- 3) 宮内 達広 (東芝), 石原 隆史 (松下電器産業), 高鹿 昌彦 (和光純薬工業), 佐藤 恒司 (富士通), 里山 雅也 (エーザイ), 保坂 享 (日本ゼオン), 渡邊 恵理子 (日本アイ・ピー・エム)
- 4) 佐治 博 (リコー), 佐藤 健作 (日本電気), 鈴木 義一 (アイシン精機), 吉川 千雅 (三菱電機), 渡部 比呂志 (日本電信電話)
- 5) 木下 京 (三共), 工藤 裕文 (富士ゼロックス), 坂田 大 (富士通), 田中 実 (ソニー), 水野 博美 (富士写真フィルム), 吉田 芳樹 (藤沢薬品工業)
- 6) 遠藤 隆 (リコー), 木田 義治 (東芝), 北岡 一人 (日立製作所), 中原 健吾 (松下電器産業), 藤本 久夫 (日本電気), 宮島 正博 (ソニー), 熊澤 佳明 (住友電気工業)
- 7) 日高 啓視 (フジクラ), 池谷 昭二 (東芝テック), 江畑 勝紀 (テルモ), 大谷 孝公 (アステラス製薬), 多田 有為 (オムロン), 堀川 剛史 (富士通), 泉川 達也 (田辺製薬), 中山 美加 (JSR)

(原稿受領日 2005年3月4日)